

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）



代理人 前田 弘  様  あて名 〒541-0053 日本国大阪府大阪市中央区本町2丁目5番7号 大 阪丸紅ビル
--

PCT  
 国際調査機関の見解書  
 （法施行規則第40条の2）  
 [PCT規則43の2.1]

発送日  
 （日・月・年）

23.8.2005

出願人又は代理人 の書類記号 M04-V-348CT1	今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2005/009268	国際出願日 （日・月・年） 20.05.2005	優先日 （日・月・年） 03.06.2004
国際特許分類（IPC）IntCl. <sup>7</sup> H01L21/3205, 21/768		
出願人（氏名又は名称） 松下電器産業株式会社		

## 1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☒ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

## 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

## 3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

10.08.2005

名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 綿引 隆 電話番号 03-3581-1101 内線 3498	4 L	3 2 3 9
---	--	-----	---------

様式PCT/ISA/237（表紙）（2004年1月）

## 第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、  
以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

## 第IV欄 発明の単一性の欠如

1. 追加手数料納付の求め(様式PCT/ISA/206)に対して、出願人は、

☐ 追加手数料を納付した。

☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。

☒ 追加手数料の納付はなかった。

2. ☐ 国際調査機関は、発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際調査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

☐ 満足する。

☒ 以下の理由により満足しない。

請求の範囲1～53に記載された発明は、絶縁膜と接するバリアメタル膜が、当該絶縁膜を構成する元素のうち少なくとも1つを含むという事項でのみ連関すると認められる。しかしながら、層間絶縁膜としてシリコン酸化膜を用い、バリアメタルとしてシリコンを含む膜を用いることは当業者には広く知られた技術(必要があれば、JP2002-231723A, 段落番号【0024】～【0038】、図1～図3(テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド)を参照)であり、このような技術をも含む前記事項は、「特別な技術的特徴」とはなり得ない。ゆえに、請求の範囲1～53に記載されている一群の発明は、発明の単一性の要件を満たしていない。

次に、この国際出願の請求の範囲に記載されている、一般的発明概念を形成するように連関している発明の群の数、すなわち、発明の数につき検討すると、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様からして、この国際出願の請求の範囲には、[1～7]、[8～15]、[16～18]、[19～22]、[23～31]、[32～35]、[36～45]、[46～49]、[50～53]とに区分される9個の発明が記載されていると認める。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。

☐ すべての部分

☒ 請求の範囲1-7

に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-7	無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-7	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-7	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

- 文献1 : JP 2003-297919 A (株式会社東芝) 2003. 10. 17, 段落番号【0018】 - 【0023】、図1  
 文献2 : JP 2002-110788 A (株式会社東芝) 2002. 04. 12, 段落番号【0029】 - 【0045】、図1  
 文献3 : WO 2000/048241 A1 (旭硝子株式会社) 2000. 08. 17, 全文、全図  
 文献4 : JP 5-218035 A (シャープ株式会社) 1993. 08. 27, 全文、全図  
 文献5 : JP 2000-252357 A (日本電気株式会社) 2000. 09. 14, 段落番号【0018】 - 【0030】、図1-5  
 文献6 : JP 11-330075 A (東京エレクトロン株式会社) 1999. 11. 30, 段落番号【0013】 - 【0022】、図1-4  
 文献7 : JP 2002-353306 A (テキサス インストルメンツ インコーポレイテッド) 2002. 12. 06, 段落番号【0009】 - 【0011】、図1  
 文献8 : JP 2002-231723 A (テキサス インストルメンツ インコーポレイテッド) 2002. 08. 16, 段落番号【0024】 - 【0038】、図1-3

請求の範囲 1, 2, 6, 7

上記請求の範囲に記載された発明は、文献1、文献2によって、新規性、進歩性を有さない。文献1について、ポリイミドは窒素を含む膜である。

請求の範囲 1, 3, 6, 7

上記請求の範囲に記載された発明は、文献3によって、新規性、進歩性を有さない。

また、上記請求の範囲に記載された発明は、文献4によって、進歩性を有さない。文献4に記載の、 $\text{SiO}_2$ へのCuの拡散を $\text{RuO}_2$ からなるバリアメタルによって防ぐ技術を、埋め込み配線に適用することは、当業者が容易に想到し得たことである。

請求の範囲 1, 4, 6, 7

上記請求の範囲に記載された発明は、文献5、文献6によって、新規性、進歩性を有さない。

請求の範囲 1, 5-7

上記請求の範囲に記載された発明は、文献7、文献8によって、新規性、進歩性を有さない。